

РЕЛАКСАЦИЯ ГОРЯЧИХ ЭЛЕКТРОНОВ НА РАВНОВЕСНЫХ ФЛУКТУАЦИЯХ ПЛОТНОСТИ ДЫРОЧНОЙ ПЛАЗМЫ

Федирко В. А., Захарова А. А.

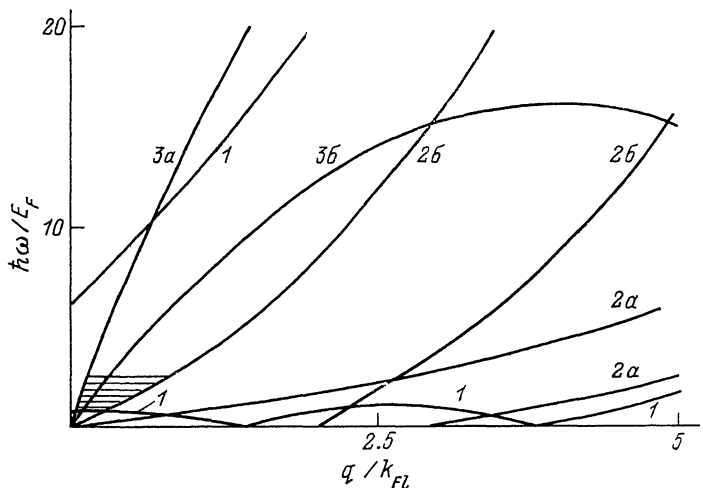
Рассмотрены особенности релаксации горячих электронов на равновесных колебаниях дырочной плазмы в полупроводниках p -типа. Показано, что из-за интенсивных переходов частиц из зоны тяжелых дырок в зону легких резонансное испускание плазмонов оказывается существенным образом подавленным. Рассеяние горячих электронов на колебаниях плазмы в этих условиях происходит преимущественно с возбуждением тяжелой дырки в зону легких дырок, причем вследствие динамического экранирования энергетические потери распределены в широкой полосе и могут быть больше, чем в случае резонансного испускания плазмонов определенной энергии.

1. Интерес к исследованию коллективных возбуждений дырочной плазмы в полупроводниках p -типа стимулируется активными работами по созданию биполярных гетеротранзисторов (БГТ) на основе соединений $A^{III}B^V$ и их композиций (см., например, [1] и цитируемую там литературу). Теоретическое исследование и численное моделирование переноса неравновесных носителей в униполярных транзисторах на горячих электронах [2-4] показывают, что испускание плазмонов оказывается существенным механизмом рассеяния инжектируемых высокоэнергетических электронов в базе. Вопрос о влиянии равновесных колебаний дырочной плазмы на перенос в базе БГТ обсуждается в [5]. В указанной работе предполагалось резонансное испускание плазмонов определенной энергии.

Однако вследствие более сложной структуры энергетического спектра носителей заряда в валентной зоне прямая аналогия дырочной плазмы с плазмой электронов проводимости в полупроводнике n -типа не является очевидной. Как известно, валентная зона полупроводников $A^{III}B^V$ вблизи центра зоны Бриллюэна расщепляется на две двухкратно вырожденные подзоны с существенно различающимися эффективными массами: для арсенида галлия отношение массы тяжелых дырок m_h к массе легких m_l составляет ~ 7 . Наличие двух ветвей спектра делает дырочную плазму в отличие от электронной двухкомпонентной. Существенным является то обстоятельство, что интеграл перекрытия между волновыми функциями различных подзон отличен от нуля (ср. с [6]). Это делает возможными переходы между подзонами и приводит к дополнительному механизму затухания плазменных колебаний [7]. Простой анализ законов сохранения показывает, что он вызывает распад гораздо более длинноволновых плазмонов, чем обычное затухание Ландау. Вклад в диэлектрическую проницаемость, связанный с переходами между зонами тяжелых и легких дырок, может быть столь существен, что резонансное испускание плазмонов оказывается подавленным. Рассеяние горячих электронов в этой ситуации на колебаниях плазмы происходит с возбуждением тяжелой дырки в зону легких дырок. Численный расчет частот релаксации горячих электронов с учетом этих эффектов проводился в работе [8] на основе результатов [9], а также в [10]. Интересно, что рассчитанные частоты релаксации оказались существенно больше, чем на ионизованных примесях.

В настоящей работе теоретически исследуются особенности рассеяния горячих электронов на равновесных флуктуациях плотности дырочной плазмы. Показано, что энергетические потери распределены в довольно широкой] полосе $E_F < \hbar\omega < \alpha E_F$ (где $\alpha = m_h/m_l$, E_F — энергия Ферми дырок) и могут превышать потери, вычисленные в модели резонансного испускания плазмонов определенной энергии. Расчеты проводятся с использованием поляризационного приближения для интеграла столкновений.

2. Мы проведем рассмотрение коллективных возбуждений для низких температур, когда дырочную плазму можно считать вырожденной и слабо неидеальной. Эти условия выполняются для характерных концентраций дырок $p_0 \sim (10^{18} \div 5 \cdot 10^{19}) \text{ см}^{-3}$ в GaAs при температурах ниже азотных. Несмотря на определенные ограничения, такое рассмотрение позволяет получить наиболее наглядное и обоснованное представление о характере возникающих особенностей.



Спектр элементарных возбуждений в вырожденной дырочной плазме при $\alpha=7$.

1, 2a, 2b ограничивают области существования элементарных возбуждений: 1 — пары легкая дырка на уровне Ферми и валентный электрон в зоне тяжелых дырок под уровнем Ферми или тяжелая дырка на уровне Ферми и валентный электрон в зоне легких дырок под уровнем Ферми, 2a — пары тяжелая дырка над уровнем Ферми и валентный электрон в зоне тяжелых дырок под уровнем Ферми, 2b — пары легкая дырка над уровнем Ферми и валентный электрон в зоне легких дырок. 3a и 3b ограничивают область интегрирования при $E_p/E_{Fl} = 64$ и 16 соответственно. Заштрихована область интегрирования в (13) при $E_p/E_{Fl} = 64$.

Рассмотрение выполняется на основе анализа диэлектрической проницаемости плазмы $\epsilon(\omega, \mathbf{q})$, где ω — частота, \mathbf{q} — волновой вектор колебаний:

$$\epsilon(\omega, \mathbf{q}) = \kappa - \frac{4\pi e^2}{q^2} \sum_{a, b, \mathbf{k}} |G_{\mathbf{k}, \mathbf{k}+\mathbf{q}}^{a, b}|^2 \frac{n_{\mathbf{k}}^a - n_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^b}{E_{\mathbf{k}}^a - E_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^b + \hbar\omega + i0} = \kappa + \epsilon_h(\omega, \mathbf{q}) + \epsilon_l(\omega, \mathbf{q}) + \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}). \quad (1)$$

Здесь κ — диэлектрическая проницаемость решетки, $n_{\mathbf{k}}^a$ — фермиевское число заполнения состояния подзоны типа a с волновым вектором \mathbf{k} , $E_{\mathbf{k}}^a$ — энергия этого состояния, $G_{\mathbf{k}, \mathbf{k}+\mathbf{q}}^{a, b}$ — фактор перекрытия волновых функций состояний $|ka\rangle$ и $|kb\rangle$, ϵ_h , ϵ_l и ϵ_{hl} — соответствующие вклады в диэлектрическую проницаемость, связанные с переходами в зоне тяжелых и легких дырок и переходами между зонами. Вкладом легких дырок в дальнейшем мы будем пренебрегать в силу малости отношения эффективных масс.

На рисунке показана область на плоскости (ω, q) , где $\text{Im } \epsilon_{hl} \neq 0$ (кривые 1). Эта область ограничивается сверху неравенством

$$\omega < \hbar(k_{Fl} + q)^2/2m_l - E_F/\hbar \quad (2)$$

и снизу следующим образом:

$$\begin{aligned} \omega > E_F/\hbar - \hbar(k_{F_l} + q)^2/2m_h \quad \text{при} \quad 0 \leq q \leq k_{F_h} - k_{F_l}, \\ \omega > E_F/\hbar - \hbar(k_{F_h} - q)^2/2m_l \quad \text{при} \quad k_{F_h} - k_{F_l} \leq q \leq k_{F_h} + k_{F_l}, \\ \omega > -E_F/\hbar + \hbar(k_{F_l} - q)^2/2m_h \quad \text{при} \quad q \geq k_{F_h} + k_{F_l}. \end{aligned} \quad (3)$$

Здесь $k_{F_h} = (2m_h E_F)^{1/2}/\hbar$, $k_{F_l} = (2m_l E_F)^{1/2}/\hbar$. В указанной области имеет место бесстолкновительное затухание плазменных колебаний, связанное с возбуждением тяжелой дырки из состояния под уровнем Ферми в состояние зоны легких дырок над уровнем Ферми (или легкой дырки из состояния под уровнем Ферми в состоянии в зоне тяжелых дырок над уровнем Ферми) при аннигиляции плазмона — межзонный аналог затухания Ландау. Фактически в этой области плазмоны как хорошо определенные элементарные возбуждения не существуют: это есть область существования пар типа легкая дырка над уровнем Ферми — валентный электрон в состоянии тяжелой дырки под уровнем Ферми. Как видно из рисунка, при $E_F < \hbar\omega < \alpha E_F$, затухание колебаний плазмы имеет место при всех $q \geq 0$. На рисунке показаны также области обычного затухания Ландау, связанного с возбуждением тяжелых (кривые 2а) и легких (кривые 2б) дырок. Поскольку при всех практически интересных концентрациях $10^{15} \div 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ в полупроводнике типа GaAs выполняется условие $E_F < \hbar\omega_p < \alpha E_F$ (ω_p — плазменная частота), плазмоны в дырочной плазме таких полупроводников в общепринятом смысле как хорошо определенные элементарные возбуждения не существуют. Поэтому модель релаксации горячих электронов в полупроводнике *p*-типа на плазмонах не является физически адекватной: при всех $q \geq 0$ релаксация связана со столкновениями быстрого электрона и тяжелой дырки с возбуждением последней в зону легких дырок. При малых $q < k_{F_h}$ имеет место существенное динамическое экранирование этого взаимодействия [11] (ср. с [5, 6]).

В области значений ω и q , когда можно пренебречь кинетической энергией тяжелой дырки, имеем приближенные аналитические выражения для $\text{Im } \varepsilon_{hl}(\omega, q)$ и $\text{Re } \varepsilon_{hl}(\omega, q)$

$$\begin{aligned} \text{Im } \varepsilon_{hl}(\omega, q) = \frac{3e^2}{32\hbar\omega q^3} \{ [k_{\max}^2 - (k_\omega - q)^2] [(k_\omega + q)^2 + (k_\omega - q)^2] - k_{\max}^4/2 + \\ + (k_\omega - q)^4/2 - (k_\omega - q)^2(k_\omega + q)^2 \ln [k_{\max}^2/(k_\omega - q)^2] \}, \end{aligned} \quad (4)$$

где $k_{\max} = \min(k_{F_h}, k_\omega + q)$, $k_\omega = (2m_l \omega/\hbar)^{1/2}$. Выражение (4) совпадает с полученным в (9) для $\alpha \gg 1$ при $(q/k_\omega)^2 \ll \alpha$, $\hbar\omega > E_F$. При малых $q < k_\omega$ формула (4) существенно упрощается и переходит в известное выражение (см., например, [12])

$$\text{Im } \varepsilon_{hl}(\omega, q) = \frac{2m_l e^2}{\hbar^2 k_\omega}, \quad (5)$$

если $q < k_{F_h} - k_\omega$. При $q \gg |k_{F_h} - k_\omega|$ ($\hbar\omega \sim \alpha E_F$)

$$\text{Im } \varepsilon_{hl}(\omega, q) = \frac{m_l e^2}{\hbar^2 k_\omega}. \quad (6)$$

При $q \approx k_\omega - k_{F_h}$ ($\hbar\omega > \alpha E_F$) $\text{Im } \varepsilon_{hl}(\omega, q)$ обращается в нуль. В области сравнительно больших q , когда $k_\omega \ll q \ll k_{F_h}$,

$$\text{Im } \varepsilon_{hl}(\omega, q) = \frac{2m_l e^2 k_\omega}{\hbar^2 q^2}. \quad (7)$$

Для $\text{Re } \varepsilon_{hl}(\omega, q)$ при $q \ll k_\omega$, k_{F_h} справедливо следующее представление:

$$\text{Re } \varepsilon_{hl}(\omega, q) = -\frac{3m_l e^2}{\pi \hbar^2 k_\omega} I, \quad (8)$$

где

$$\begin{aligned} I = -\{ [1/3 + (k_{F_h} - k_\omega)/2q - (k_{F_h} - k_\omega)^3/6q^3] \ln |1 - t| + [1/3 + (k_{F_h} + k_\omega)/2q - \\ - (k_{F_h} + k_\omega)^3/6q^3] \ln |1 + t| \} |t_3^2 + \{ k_\omega^2 k_{F_h} t/q^3 - k_\omega^3 t^2/6q^3 \} |t_3^2 - \\ - \{ 2(\ln |(1+t)/(1-t)|)/3 \} |t_3^2, \end{aligned} \quad (9)$$

$$t_1 = (E_F/\hbar\omega)^{1/2}, \quad t_2 = (k_{Fh} + q)/k_\omega, \quad t_3 = (k_{Fh} - q)/k_\omega.$$

При $q \ll |k_{Fh} - k_\omega|$ в пренебрежении пространственной дисперсией

$$\operatorname{Re} \varepsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) = -\frac{2m_l e^2}{\pi \hbar^2 k_\omega} \ln \left| \frac{(k_{Fh} + k_\omega)(k_{Fl} - k_\omega)}{(k_{Fh} - k_\omega)(k_{Fl} + k_\omega)} \right|. \quad (10)$$

При $q=0$ в пределе низких частот $\omega \ll E_F/\hbar$ формула (10) совпадает с результатом [13], однако отличается от приведенного в [9] при аналогичных значениях параметров. Если $q \gg |k_{Fh} - k_\omega|$ ($\hbar\omega \sim \alpha E_F$),

$$\operatorname{Re} \varepsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) = -\frac{2m_l e^2}{\pi \hbar^2 k_\omega} \left[\ln \left| \frac{(k_{Fh} + k_\omega)(k_{Fl} - k_\omega)}{q(k_{Fl} + k_\omega)} \right| + \frac{4}{3} \right]. \quad (11)$$

3. Вероятность перехода горячего электрона из состояния с импульсом \mathbf{p} в состояние с импульсом $\mathbf{p}' = \mathbf{q} - \hbar\mathbf{q}$ при рассеянии на равновесных флуктуациях плотности заряда дырочной плазмы дается выражением (см., например, [14])

$$W_{\mathbf{p}, \mathbf{p}-\hbar\mathbf{q}} = -\frac{8\pi e^2}{\hbar^2 q^2 V} \operatorname{Im} \varepsilon^{-1}(\omega, \mathbf{q}) |_{\hbar\omega = E_{\mathbf{p}} - E_{\mathbf{p}-\hbar\mathbf{q}}}, \quad (12)$$

где V — объем системы, $E_{\mathbf{p}}$ — энергия горячего электрона. Нетрудно убедиться, что при $q \gg k_{Fh}$ (12) переходит в формулу для вероятности рассеяния электрона на тяжелой дырке с возбуждением последней в зону легких дырок, аналогичную используемой в [6].

При $q < k_{Fh}$, как можно видеть из (4)–(12), вероятность перехода не обладает δ -образной структурой, поэтому переходы имеют место с потерей энергии в широкой полосе, где $\operatorname{Im} \varepsilon \neq 0$ (см. рисунок). Оценки показывают, что при $10^{17} < p_0 < 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ $\omega_p \gg E_F/\hbar$ для GaAs. Тогда $\operatorname{Im} \varepsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) \approx 2m_l e^2/\hbar^2 k_\omega$ при $q \ll k_\omega$. Полагая $p_0 = 10^{18} \text{ см}^{-3}$, $m_h = 5 \cdot 10^{-28} \text{ г}$, $m_l = 7 \cdot 10^{-29} \text{ г}$, $\kappa = 12$, имеем $\operatorname{Im} \varepsilon_{hl}(E_F/\hbar, 0) \gg \kappa$. [При этом, если оценить логарифм в (10) единицей, $|\operatorname{Re} \varepsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q})| \approx 2m_l e^2/\pi \hbar^2 k_\omega$ в несколько раз меньше]. Если $p_0 > 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $\operatorname{Im} \varepsilon_{hl}(E_F/\hbar, 0) \ll \kappa$. Резонансное испускание плазмонов определенной энергии не реализуется.

Частота переходов электрона во все возможные состояния из состояния с импульсом \mathbf{p} определяется интегралом

$$\bar{\nu} = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\Omega} d^3 q W_{\mathbf{p}, \mathbf{p}-\hbar\mathbf{q}} = -\frac{e^2}{\pi^2 \hbar} \int_{\Omega} \frac{d^3 q}{q^2} \operatorname{Im} \varepsilon^{-1}(\omega, \mathbf{q}) |_{\hbar\omega = E_{\mathbf{p}} - E_{\mathbf{p}-\hbar\mathbf{q}}}. \quad (13)$$

Область интегрирования Ω на плоскости (ω, q) ограничивается кривой:

$$\omega(q) = \mathbf{q}(\mathbf{p} - \hbar\mathbf{q}/2)/m_c = \mathbf{q}\mathbf{v} - \hbar q^2/2m_c, \quad (14)$$

где v — скорость электрона, m_c — эффективная масса. Кривые (14) для ряда значений энергии горячего электрона приведены на рисунке (кривые 3). Согласно (7), основной вклад в интеграл (13) при $q \ll k_{Fh}$ дает область волновых векторов $q < k_\omega$. Это позволяет воспользоваться выражениями (4)–(11) для вычисления вклада в частоту рассеяния длинноволновых ($q \ll k_{Fh}$) флуктуаций плотности заряда плазмы. Интегрирование, однако, даже в этом случае может быть выполнено только численно. Оценку снизу для частоты рассеяния на длинноволновых флуктуациях плотности $\bar{\nu}$ можно получить для $E_{\mathbf{p}} > \alpha E_F$, ограничившись областью

$$p/\hbar - (p^2/\hbar^2 - k_\omega^2)^{1/2} = q_{\min} < q < q_{\max} = -k_{Fl} + (k_{Fl}^2 + k_\omega^2)^{1/2} < k_\omega, \\ E_F \leq E_{\min} < \hbar\omega < E_{\max} \leq \alpha E_F. \quad (15)$$

Здесь мы считаем $m_c = m_l$. При $E_{\min} \approx E_F$, $E_{\max} = \sqrt{\alpha} E_F$ во всей области (15) (на рисунке заштрихована) справедливо представление (5) для $\operatorname{Im} \varepsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q})$, а $|\operatorname{Re} \varepsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q})|$ заметно меньше. Полагая $\omega_p \gg E_F/\hbar$, находим, что почти

во всей области (15) $|\epsilon_h(\omega, \mathbf{q})| < \kappa$. Тогда для оценки снизу величины $\bar{\nu}$ воспользуемся следующим представлением для величины $\text{Im} \epsilon^{-1}(\omega, \mathbf{q})$:

$$\text{Im} \epsilon^{-1}(\omega, \mathbf{q}) = -\frac{\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q})}{\kappa^2 + (\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}))^2}. \quad (16)$$

Полагая $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) = \frac{2m_l e^2}{\hbar^2 k_\omega} > \kappa$, имеем

$$\bar{\nu} = \frac{2^{3/2} \alpha^{3/2} E_F^{3/2} \ln(v/v_{Fl})}{3\pi \hbar v \sqrt{m_l}}. \quad (17)$$

Здесь мы при интегрировании, воспользовавшись плавностью логарифмической функции, положили $\ln(q_{\max}/q_{\min}) \approx \ln(v/v_{Fl})$, $v_{Fl} = \hbar k_{Fl}/m_l$. При $p_0 = 10^{18} \text{ см}^{-3}$, $m_l = m_c = 7 \cdot 10^{-29} \text{ г}$, $\alpha = 7$, $E_p = 0.3 \text{ эВ}$ $\bar{\nu} = 5 \cdot 10^{12} \text{ с}^{-1}$, что сравнимо с частотой испускания полярных оптических фононов в GaAs и превышает частоту примесного рассеяния.

Поскольку область интегрирования, как видно из рисунка, может составлять лишь небольшую долю существенной для (13) области в плоскости (ω, q) , частота рассеяния горячего электрона на длинноволновых колебаниях плазмы может быть реально в несколько раз больше. Для того чтобы получить представление о порядке величины $\bar{\nu}$, оценим снизу интеграл (13) в области (15), положив $E_{\min} \approx E_F$, $E_{\max} \approx \alpha E_F$. (Вклад области $\omega > \alpha E_F/\hbar$ может быть невелик в силу того, что при $k_\omega \approx k_{Fh} + q \text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q})$ обращается в нуль). Воспользовавшись выражением (16) для $\text{Im} \epsilon^{-1}(\omega, \mathbf{q})$, рассмотрим два предельных случая. Первый случай соответствует достаточно низким значениям концентрации дырок p_0 , когда во всей области интегрирования выполняется неравенство $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) > \kappa$. (Это эквивалентно для GaAs $p_0 < 10^{18} \text{ см}^{-3}$). Второй случай — достаточно высоким значениям p_0 , когда $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) < \kappa$ (при $p_0 > 10^{19} \text{ см}^{-3}$). При $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) > \kappa$ для оценки снизу (13) положим $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) \approx 2m_l e^2/\hbar^2 k_\omega$, тогда

$$\bar{\nu} = \frac{2^{3/2} \alpha^{3/2} E_F^{3/2} \ln(v/v_{Fl})}{3\pi \hbar v \sqrt{m_l}}. \quad (18)$$

Эта величина сравнима с частотой испускания полярных оптических фононов в GaAs при $p_0 = 10^{17} \text{ см}^{-3}$, если $E_p = 0.3 \text{ эВ}$, но намного больше соответствующих частот релаксации на примесях и тяжелых дырках по механизму, рассмотренному в работе [6]. Аналогичный результат получен авторами [8].

При $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) < \kappa$ для оценки снизу (13) положим $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) \approx \approx m_l e^2/\hbar^2 k_\omega$. Тогда

$$\bar{\nu} = \frac{2^{3/2} e^4 \sqrt{m_h} E_F^{1/2} \ln(v/v_{Fl})}{\pi \kappa^2 \hbar^3 v}. \quad (19)$$

В соответствии с (19) величина $\bar{\nu}$ меняется слабо с ростом концентрации дырок при больших уровнях легирования полупроводника p -типа. Однако следует иметь в виду, что реально эта величина может быть больше в рассматриваемом предельном случае, если учесть в выражении для $\text{Im} \epsilon^{-1}(\omega, \mathbf{q})$ член $\epsilon_h(\omega, \mathbf{q})$. При этом $\bar{\nu}$ увеличится за счет переходов с $\omega \approx \omega_p \gg E_F/\hbar$. Здесь мы не рассматриваем также процессы испускания электронами длинноволновых полярных оптических фононов и величину κ для простоты считаем постоянной, что не приводит к существенным погрешностям.

Оценим таким же образом скорость энергетических потерь Q :

$$Q = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\Omega} d^3 q \hbar \omega W_{\mathbf{p}, \mathbf{p}-\hbar \mathbf{q}} | \hbar \omega = E_{\mathbf{p}} - E_{\mathbf{p}-\hbar \mathbf{q}} |, \quad (20)$$

где область интегрирования Ω определяется соотношениями (15), причем $E_{\min} \approx E_F$, $E_{\max} \approx \alpha E_F$. В предельном случае сравнительно небольших концентраций дырок, когда $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) > \kappa$, полагая $\text{Im} \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) \approx 2m_l e^2/\hbar^2 k_\omega$ в (16), получаем оценку снизу интеграла (20):

$$Q = 3\alpha E_F \bar{\nu} / 5, \quad (21)$$

где \bar{v} определяется выражением (18). При $p_0=10^{17}$ см $^{-3}$, $E_p=0.3$ эВ для GaAs величина Q , вычисленная по этой формуле, численно близка к соответствующей величине, найденной с использованием модели резонансного испускания плазмонов определенной энергии. При принятой концентрации дырок это намного меньше скорости энергетических потерь на полярных оптических фононах. При $p_0=10^{18}$ см $^{-3}$ последние становятся меньше.

При $\text{Im } \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) < \kappa$, полагая в (16) $\text{Im } \epsilon_{hl}(\omega, \mathbf{q}) = m_l e^2 / \hbar^2 k_\omega$, имеем оценку снизу интеграла (20) в этом предельном случае:

$$Q = \alpha E_F \bar{v} / 3, \quad (22)$$

где \bar{v} определяется выражением (19). Эта величина превышает в $\alpha/4$ раз потери энергии, вычисленные в модели резонансного испускания плазмонов с энергией $\hbar\omega_p$. Отметим, что эта величина может также превышать потери энергии горячего электрона на тяжелой дырке с переходом ее в зону легких дырок при $q \gg \gg k_{Fh}$ по механизму, рассмотренному в работе [6], например при $E_p \ll \alpha E_F$, когда актуальной области волновых векторов $k_{Fh} \ll q \ll p/\hbar$ не существует.

Таким образом, рассеяние горячих носителей заряда на длинноволновых равновесных флуктуациях плотности заряда дырочной плазмы в полупроводниках p -типа не может быть описано в терминах резонансного испускания плазмонов определенной энергии. Рассеяние протекает с потерей энергии в весьма широком диапазоне $E_F < \hbar\omega < \alpha E_F$. Частоты рассеяния могут быть сравнимы или превышать соответствующие частоты для других актуальных механизмов рассеяния, например на полярных оптических фононах. Энергетические потери могут превышать как соответствующие потери, полученные в модели резонансного испускания плазмонов, так и связанные с межчастичным рассеянием электрона на тяжелой дырке с переходом последней в зону легких дырок с $q \gg k_{Fh}$.

Описанные эффекты необходимо учитывать при численном моделировании переноса горячих электронов в полупроводниках p -типа.

Авторы признательны В. Л. Борблику и В. И. Рыжю за полезное обсуждение работы.

Список литературы

- [1] Пожела Ю. Физика быстродействующих транзисторов. Вильнюс, 1989. 264 с.
- [2] Вьюрков В. В., Федирко В. А. // Электрон. техн. Сер. 3. «Микроэлектроника». 1988. В. 2 (126). С. 61—63.
- [3] Gružinskis V., Karšulis S., Mickevičius R., Požela J., Reklaitis A. // Proc. of the V Int. Conf. on hot carriers in Semicond. 1987. P. 73.
- [4] Hess K. // Proc. IEEE. 1988. V. 76. N 5. P. 519—532.
- [5] Константинов О. В., Мезрин О. А., Трошков С. И. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 3. С. 508—516.
- [6] Дьяконов М. И., Перель В. И., Ясневич И. Н. // ФТП. 1977. Т. 11. В. 7. С. 1364—1370.
- [7] Федирко В. А. // Математическое моделирование элементов и фрагментов БИС. Тез. докл. Всес. конф. Рига, 1990. С. 81.
- [8] Levi A. F. J., Yofet Y. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51. N 1. P. 42—44.
- [9] Bardyszewski W. // Sol. St. Commun. 1986. V. 57. N 11. P. 873—876.
- [10] Young J. F., Heury N. L., Kelly P. J. // Sol. St. Electron. 1989. V. 32. N 12. P. 1567—1571.
- [11] Федирко В. А., Захарова А. А. // Математическое моделирование физических процессов в полупроводниках и полупроводниковых приборах. Тез. докл. IV Всес. совещ. Ярославль, 1990. С. 103.
- [12] Мурзин В. Н. // ФТП. 1973. Т. 7. В. 8. С. 1610—1611.
- [13] Ребане Ю. Т. // ФТП. 1980. Т. 14. В. 2. С. 289—294.
- [14] Пайнс Д. Элементарные возбуждения в твердых телах. М., 1965. 199 с.

Физико-технологический институт
АН СССР
Москва

Получена 4.03.1991
Принята к печати 14.05.1991